

Tagesordnung

43. Treffen der Nutzergruppe *Heißprozesse und RTP*

Fraunhofer IISB
Erlangen

11. April 2018

13:00 Uhr	Kaffee
-----------	--------

14:00 Uhr	Begrüßung Anton Bauer, <i>Fraunhofer IISB, Erlangen</i> Wilfried Lerch
14:05 Uhr	Semiconductor Doping by Atomic Layer Deposition of Thin Film Dopant Sources Followed by Rapid Thermal Annealing Bodo Kalkofen, <i>Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg</i>
14:25 Uhr	Large Scale Graphene Integration for Silicon Technologies Alexander Scheit, <i>IHP, Frankfurt (Oder)</i>
14:50 Uhr	Tbd Silke Hamm, <i>Mattson Thermal Products, Dornstadt</i>

15:10 Uhr	Kaffeepause
-----------	-------------

15:45 Uhr	O₂ Partial Pressure Reduction at High Oxidation Temperature for Advanced 4H-SiC Gate Oxides Anton Bauer, <i>Fraunhofer IISB, Erlangen</i>
16:15 Uhr	Processing of Ohmic Contacts for SiC Power Devices Tomasz Sledziewski, <i>Fraunhofer IISB, Erlangen</i>
16:35 Uhr	Abschlussdiskussion
16:45 Uhr	Ende der Vortragsreihe

Ab 19:00 Uhr	Gemeinsamer Abend im Restaurant "Goldener Hecht" in Erlangen
--------------	---
